

開示の要約

膜厚測定装置、膜厚測定方法、および膜厚測定装置を備えた研磨装置

- 膜厚の測定精度を向上させることができる膜厚測定装置および膜厚測定方法が開示される。膜厚測定装置は、基板を水平に支持する基板ステージと、基板ステージ上の基板の表面全体にリンス水を供給するリンス水供給部と、基板ステージ上の基板の表面上の測定領域に光を照射し、測定領域からの反射光のスペクトルを生成し、該スペクトルから基板の膜厚を決定する膜厚測定ヘッドと、光の光路上に気体の流れを形成し、該気体の流れを測定領域に当てる流体供給部とを備える。
- 5

Figure 6A